レーザースルーホールフィリング用 硫酸銅めっき添加剤

Additives for Acid Copper Plating to Fill Laser Through-hole

トップルチナLTF

TOP LUCINA LTF

- 低膜厚でスルーホールフィリングを実現 Realize through-hole filling by thin thickness
- 低膜厚化によって配線の微細化に対応 Applicable to micro-patterning by thin thickness
- コア基板形成の工程簡略化が可能 Can reduce treatment steps by forming core substrates
- 全ての添加剤成分の定量分析が可能 Quantitative analysis is possible for all additives

低膜厚でスルーホールフィリングを実現 Realize through-hole filling by thin thickness

硫酸銅五水和物 CuSO4·5H2O 230g/L 硫酸 H₂SO₄ 70g/L 塩化物イオン cl-30mg/L 電流密度 Current density 1.0A/dm² めっき膜厚 Film thickness 15µm









